

顾尔丹

作者：材料学院 日期：2006-10-8 点击次数：3584

顾尔丹

男，出生于1956年6月。教授、博士生导师。

学科专业： 材料学

工作单位： 国家重点实验室

联系电话： 资料不详

毕业院校： 1982年毕业于徐州师范大学获理学学士学位；1988年毕业于中国科学技术大学，获理学硕士学位；1992年毕业于英国阿伯丁大学，获博士学位。

研究方向： 功能薄膜材料与器件；薄膜材料与制备技术

科研项目：

- 1、利用超高真空蒸发设备，同步辐射EXAFS，X射线衍射和高分辨电镜等手段，系统得研究和阐明了稀土薄膜的成核，生长机理，薄膜微结构和生长条件的关系。
- 2、研究了金属多层膜在X射线光学上的应用。提出了一个增加软X射线反射器带宽的新设计。
- 3、利用洛伦兹电镜和磁光克尔效应等手段，在世界上首次揭示了外延铁膜微粒的微磁结构和其对微粒的尺度，取向和磁化条件的依赖关系。
- 4、发现和证明了在Co/GaAs(001)外延体系里，钴的稳定相是双取向的六方结构而不是以前一致认为的体心结构。并正确解释了其磁性质对其结构的依赖关系。
- 5、对于Co/Cu(110)外延微粒阵列体系，首次观察到一个由于外延钴粒子扩散引起的磁相变。并发现此类体系具有可控的磁特性。
- 6、研究和制作了新型薄膜超导器件像超级超导量子干涉器(SQUID)和超导转变温度传感器(TES)。

获奖成果： 资料不详

其他信息： 资料不详

---- 来源：武汉理工大学材料科学与工程学院

关闭窗口